(19)

Office européen des brevets European Patent Office



EP 0 744 473 A1

E

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

27.11.1996 Patentblatt 1996/48 (43) Veröffentlichungstag:

(12)

(51) Int. Ct.⁶: C23C 14/08, C23C 14/00

(21) Anmeldenummer: 96106600.8

(22) Anmeldetag: 26.04.1996

AT BE CH DE DK FR GB LI SE (84) Benannte Vertragsstaaten:

01259 Dresden (DE)

(30) Prioritat: 22.05.1995 DE 19518781

(71) Anmelder: FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 80636 München (DE) FÖRDERUNG DER

01307 Dresden (DE) · Goedicke, Klaus (72) Erfinder:

Schiller, Siegfried, Prof. Dr. 01324 Dresden (DE) 01127 Dresden (DE) 09599 Freiberg (DE) Reschke, Jonathan Fletzke, Fred, Dr. Zywitzki, Olaf

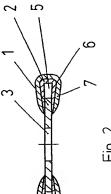
01307 Dresden (DE) 01326 Dresden (DE) Hempel, Wolfgang

Vakuumbeschichteter Verbundkörper und Verfahren zu seiner Herstellung

<u>F</u>

 C aufgebracht. Sie ist vollständig kristallin und besteht aus der α-Al₂O₃-Phase und gegebenenfalls der γ-Erfindungsgemäß ist auf dem Träger aus Metall oder einer Metallegierung mindestens eine Schicht, das ist die außere, aus Al2O3 bei maximal 700 Al₂O₃-Phase mit einer (440)-Textur, hat eine Druckspannung von mindestens 1 GPa und eine Härte von mindestens 20 GPa. (24)

Die Al₂O₃-Schicht wird durch reaktives Magnetron-Zerstäuben aufgebracht, indem die Magnetrons gepulst betrieben werden. Die Pulsfrequenz liegt zwischen 20 und 100 kHz. Die Zerstäubungsrate beträgt mindestens I mws. Die Verbundkörper werden für die spanende Bearbeitung, insbesondere als Bohrer, Fraser, Reibahle, Raumnadel oder Sägeblatt verwendet.



ġ Ġ

EP 0 744 473 A1

ende Bearbeitung, Umformwerkzeuge, Maschinenteile auf dem eine oder mehrere Oberflächenschichten aufgebracht sind, von denen mindestens eine Schicht durch Vakuumbeschichtung abgeschieden ist und aus Murniniumoxid (Al₂O₃) besteht. DerartigeVerbundkörper werden beispielsweise als Werkzeuge für die span-Die Erfindung bezieht sich auf einen Verbundkörper, dessen Träger vorzugsweise aus Metall besteht oder Führungsbahnen verwendet.

20 33 werden. Beim Einsatz in Schneidwerkzeugen unterliegen solche Verbundkörper hohen Temperaturen. Diese sind mit einer Phasenumwandlung in der Al₂O₃-Schicht, insbesondere der κ-Phase verbunden. Die Schicht, insbesondere der κ-Phase verbunden. Die besondere die k-Phase (DE 22 33 700; DE 22 53 745). Wegen der hohen Temperatur, der der Träger bei der werkzeugen, z.B. als Wendeschneidplatten, eingesetzt aber erhebliche Begrenzungen der Schneidleistung und die Art der verwendbaren Träger jedoch auf Sinterwerkwerkstoffe. Insbesondere sind alle gebräuchlichen Stähle und Nichteisenwerkstoffe ausgeschlossen, oder rung seiner Gebrauchseigenschaften. Bedeutung Schichten haben eine rauhe Oberfläche und relativ teil, daß einschneidende Grenzen für den Einsatz der gen in Grenzen zu halten, müssen die Schneidkanten des Trägers abgerundet werden. Daraus resultieren senabscheidung (CVD) bei Temperaturen oberhalb 1000°C auf dem Träger aus Sinterwerkstoff abgeschieden worden sind. Derartige Schichten sind kristallin und enthalten neben der thermodynamisch stabilen α-Phase im allgemeinen weitere metastabile Phasen, ins-Beschichtung ausgesetzt werden muß, beschränkt sich stoffe, Oxidkeramiken und andere Hochtemperaturaus Sinterwerkstoffen bestehen und die in Schneidnohe Reibungskoeffizienten. Durch eine Volumenkon-Iraktion bei der Phasenurmandlung kommt es zu einer ausgeprägten Rißbildung und einer Delamination zwischen Schicht und Träger. Daraus resultiert der Nach-Verbundkörper in Bezug auf die Gebrauchsdauer bestehen. Um die Delamination auf Schneidwerkzeuder Oberflächengüte der spanend bearbeiteten Werk-Es sind Verbundkörper bekannt, die eine Al₂O₃-Schicht enthalten, welche durch chemische Dampfphader Träger erfährt eine nicht akzeptable Verschlechtehaben deshalb nur Verbundkörper erfangt, deren Träger

Die Verwendung von Trägern aus Werkzeugstählen turen oberhafb 550°C ihre vorteilhaften Gebrauchseiist generell nicht möglich, da diese Stähle bei Temperagenschaffen verlieren.

Es sind weiterhin Verbundkörper bekannt, die eine bei niedrigen Temperaturen durch plasmagestützte CVD-Verfahren abgeschiedene Al₂O₃-Schicht besitzen DE 41 10 005; DE 41 10 006). Derartige Schichten enthalten verfahrensbedingt Verunreinigungen, die aus einer unvollständigen chemischen Reaktion herrühren. Diese Schichten weisen beispielsweise einen Chlorge-halt von 0,5 bis 3,5 % auf. Die Al₂O₃-Schichten auf die-

Gitterverzerrungen infolge des Fremdstoffgehaltes der Schichten und nicht, wie angegeben, nur auf die Feinkornigkeit des Gefüges der A₂O₃-Schichten zunückge-Verfahren die Verwendung toxischer Substanzen und Aluminiumoxids. Daraus ergibt sich der Nachteil, daß sowohl die Verunreinigungen im Al2O3 als auch die bundkörpern bekannt. Dabei wird eine aus der feinstrukturanalyse (XRD) der Schichten abgeleitete Als Herstellungsverfahren wird ein Plasma-CVD-Verfahren mit den obengenannten Nachteilen beschrieben (DE 41 10 005; DE 41 10 006). Es kann angenommen werden, daß die Linienbreite im XRD vorwiegend auf führt werden muß. Generell erfordern alle CVDsen Verbundkörpern enthalten neben kristallinem α-Al₂O₃ im allgemeinen einen hohen Anteil amorphen mechanische und thermische Beständigkeit der Schicht auf dem Verbundkörper bewirken. Es sind auch feinkörnige, nur aus α-Al₂O₃ bestehende Schichten auf Ver-Bemessungsregel für die Feinkörnigkeit angegeben. amorphe Phase eine unzureichende chemische, Halbwertsbreite der Interferenzlinien bei der Römtgensind deshalb umweltbelastend.

bundkörper bei der Beschichtung einer Temperatur von mindestens 1000 °C ausgesetzt wird. Anderenfalls ist eine nachträgliche Wärmebehandfung bei 1000 ... 1250 °C erforderlich. Die damit verbundenen Nachteile ent-Es ist weiterhin bekannt, Al2O3-Schichten auf Trägerkörpern durch Hochfrequenz-Dioden- oder -Magnefron-Zerstäubung abzuscheiden (Thornton und Chin, Ceramic Bulletin, 56 [1977]504). Es wird beschrieben, daß kristalline α-Al₂O₃-Schichten mit diesem Verfahren ebenfalls nur erzeugt werden können, wenn der Versprechen denen der Schichten, die durch CVD-Verfahren abgeschieden worden sind.

ten, die durch Zerstäubung hergestellt wurden, eine relativ hohe Härte erreicht werden kann, aber diese was nachteilig für die Stabilität beim Einsatz ist (Sche-Es wurde auch beschrieben, daß bei Al₂O₃-Schich-Schichten weisen eine röntgenamorphe Struktur auf, rer, Latz und Patz; Proc. 7th Int. Conf. IPAT, Geneva. 1989, p. 181).

von weniger als 1 nm/s ermöglichen. Werden Verbund-körper zur Erhöhung der Abscheiderate mit einer Trager hergestellt, so sind die Al2O3-Schichten poros und nicht ausreichend hart, selbst wenn der Träger bei der Beschichtung auf eine Temperatur von 1000 °C erhitzt wird (Bunshah, Schramm; Thin Solid Films 40 tet sind. Weiterhin sind die Verbundkörper, deren Träger durch CVD- oder HF-Zerstäubungsverfahren mit Al₂O₃ beschichtet sind, teuer in der Herstellung, da alle genannten Verfahren nur eine niedrige Abscheiderate Al₂O₃-Schicht durch reaktives Vakuumbedampfen der Somit ist festzustellen, daß die bekannten vakuumbeschichteten Verbundkörper stets mit Mängeln behaf-[1977[211]. 45 20

gel am Stand der Technik zu beseitigen. Es soll ein Verbundkörper mit einer thermisch, mechanisch und Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Mänchemisch stabilen Al₂O₃-Schicht geschaffen werden,

EP 0 744 473 A1

die eine glatte, rißfreie Oberflache aufweist. Das Verfahren zu seiner Herstellung soll umweitfreundlich sein, eine hohe Pozzo8stelbrilfat aufweisen und kostengünstig sein. Insbesondere soll auch ein Verbunddörper, dessen Träger aus Stahl bestelnt, geschaffen werden.

Efrirdungsgeraß wird die Aufgabe, ein Verbundkürper, mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst. Das Verfahren zu seiner Herstellung wird nach den Merkmalen des Anspruches 6 gelöst. Weilere vorteilhatte Ausgestaltungen des Verbundkürpers und des Hertellungsverfahrens sind in den Ansprüchen 2 bis 5 bzw. 7 bis 9 beschrieben.

30 15 ĸ Argon. Andere Verurreinigungen lassen sich mit gebräuchlichen Analyseverfahren wie Elektronenstrahl-Danach ware eine Aktivierungsenergie für die Bildung von $\alpha\text{-}A_2O_3$ erforderlich, die nur oberhalb einer Tempevon eine nicht im einzelnen verstandene zusätzliche Aktivierung der Komponenten Aluminium und Sauerstoff im Plasma einen nennenswerten zusätzlichen Beitrag zur vollståndig kristallinem a-Al₂O₃ herzustellen, auch Schicht eine Temperatur von maximal 700 °C nicht daß bereits eine Temperatur von 550 °C ausreicht, um besagte Schicht abzuscheiden. Die Al2O3-Schicht enthalt typischerweise einen Anteil von maximal 1 at% größe beträgt typischerweise 0,5...2 µm. Die Eigenweitgehend wenn besagte Al₂O₃-Schicht nicht ausschließlich in der α-Phase vorliegt, sondern teilweise aus texturiertem 7-Ah2O3 besteht. Für diese Schichten wird eine geringere Kristallitgröße beobachtet, vorzugsweise 0,05...0,1 µm. Die Ausbildung der beschriebenen kristallinen Phasen, insbesondere die Ausbildung reiner a-Al₂O₃-Schichten, scheint im Widerspruch zu den bisher allgemein anerkannten thermodynamisch begründeten Bildungsbedingungen für diese Phase zu stehen. ratur von 1000 °C aufgebracht werden kann. Offensichtlich bewirkt das erfindungsgemäße Verfahren durch einen Verbundkörper mit einer außeren Schicht aus wenn dessen fräger während der Abscheidung der überschreitet. Es wurde dabei weiterhin festgestellt, Mikroanalyse (ESMA) nicht nachweisen. Die Kristallit-Für die Fachwelt überraschend wurde gefunden, des Verbundkörpers sind notwendigen Aktivierungsenergie. schaften identisch,

Außer den materialspezifischen Eigenschaften von cr.4g-0, sind die angegebene Bernessung der Druckeigenspannungen und die genammten Kristallitgrößen für die hohe Härte der außeren Schicht des Verbundkorpers veramtwortlich. Die geeignete Bernessung der Druckeigenspannung gewährleistel, daß kein vorzeitiges Versagen der Schicht durch mechanische Rißßeldung bei abrasiver Belastung des Verbundkorpers auftritt. Andererseits können die Druckeigenspannungen so klein gehalten werden, daß die Hattung der Al-03-Schicht auf dem Träger problemilos erreicht werden kann. Das gilt insbesondere, wenn der Träger mit einer oder mehren Obertlächenschrichten, die als Zwischenschrichten vor dem Abscheiden der Al₂O₃-Schicht aufgebracht worden sind, versehen ist. Als Zwischen-

schichten eignen sich vorteilhafterweise bekannte Hartstoffschichten wie TIN, (Ti,A)N oder TiC. Es kann auch zweckmäßig sein, den Träger zunachst nit einer oder mehreren Schichten aus Metal-len der Gruppe Ti, Zir, Cr, Al, Nb, Hi, W undloder Vertrindungen dieser Metalle in Form von Oxiden, Nitriden, Oxymitriden, Karbiden oder Carbonitriden zu versehen, der dann als Träger für die A₂O₃-Schicht dient.

ist der Verbundkörper als Werkzeug für die spanende Bearbeitung als Bohrer, Fläser, Relizehle oder Räummade ausgebilder, so bestlett der Täger aus HSS-Stahl. In diesem Anwendungstall ist die AyÖz-Schicht als außere Schicht 1 bis 12 im dick und an den Schneidkenten vorzugsweise 5 im dick.

Ist der Verbundkörper ein Umformwerkzeug, so besteht sein Tieger aus Werkzeugstahl und trägt eine außere Ai₂O₂-Schicht won 1 bis 20 µm Dicke, die jadoch vorzugsweise 5 µm dick ist. In dieser Abstührungsform weist der Verbundkörper einen geringen Reibungskeit krieinen und hohe mechanische Beständigkeit auf.

izienen und hohe mechanische Beständigkeit auf.
Werden an den Verbundkörper vor allem hohe
Anhorderungen an Hänte, mechanischen Verschleißwiderstand, Tansparenz und/der geringere Reibungskoeffizienten der Öberfläche gestellt, ist es auch je nach
Einsatzgebiet möglich, den Tägee aus Aluminium oder

einer Aluminiumlegierung herzustellen.
Weitere Einsatzgebiete für die enfindungsgemäßen
Verbundkörper sind Bauteile für führungsbahnen oder
Gleit- und Lagerelemente, die einem komplexen
mechanisch-abrasiven und chemisch-korrosiven Angriff
ausgesetzt sind. Dabei wirkt sich ebenfalls der niedrige
Reibungskoeffiziert sehr vorteilhaft aus

Die erfindungsgemaßen Verbundkörper können auch dem Angriff heißer undfoder chemisch aggressiver Medien widerstehen und finden deshalb in der Energieerzeugungs- und Antriebstechnik Verwendung.

trische Überschläge. Das vorgeschlagene Prinzip rate und Plasmadichte in der Puls-Ein-Zeit, daß offen-Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellung bekannte Grundverfahren und Einrichtungen zur schichten durch Magnetron-Zerstäubung ohne Anwendung einer HF-Entladung. Das pulsförmig erregte Plasma sichert die Stabilität des Zerstäubungsprozes-Schichten und verhindert Prozeßstörungen durch elekermöglicht die Anwendung einer so hohen Abscheidedie vermutete Plasmaaktivierung bei der Unverzichtbares Verfahrensmerkmal ist die ebenfalls pulsförmige wechselweise Beaufschlagung der sich bildenden Schicht mit negativen und positiven Ladungsdes Verbundkörpers nutzt in vorteilhafter Weise Abscheidung elektrisch isolierender Verbindungsses trotz des hohen Isolationsvermögens von A₂O₃-Schichtbildung des kristallinen a-Al2O3 erreicht wird. trägern der angegebenen Mindeststromdichte. þar 5

Eine vorteilhafte Ausgestaftung des Verfahrens nutzt Einrichtungen mit unfpolar gepulstem Plasma unter Verwerdung eines im reaktiven Gas zerstäubten At-Tanners.

EP 0 744 473 A1

Eine weitere, besonders vorteilhafte Ausgestaltung nutzt die Doppelanordnung zweier A-Targets, die durch eine bipolare (Wechsel-)Spannung gespeist werden und bei der die Al-Targets im Wechsel Katode und Anode beim Magneton-Zerstaltoen bidden.

der Al-Targets mit Al₂O₃ verbunden. Im dynamischen Die Einstellung des Sauerstoffgehaltes im Plasma wird durch geometrische Bedingungen der Zerstäubungsapparatur beeinflußt und muß deshalb experi-Der notwendige Sauerstoffgehalt ist, offenbar wegen der erhöhten Temperatur des zu beschichtenden Trägers, wesentlich höher, als er nach der allgemeinen Praxis zur Abscheidung stöchiometrischer Aluminiumoxid-Schichten eingestellt werden muß. Damit ist eine stärkere Bedeckung Gleichgewicht zwischen der Bildung von Al₂O₃ auf dem Target und seiner Wiederzerstäubung wird eine weitere Ursache dafür gesehen, daß sich in der Dampfphase Molekül-Bruchstücke befinden, die eine Voraussetzung für die Bildung kristalliner Phasen bei den verfahrensspezifisch niedrigen Temperaturen des Trägers sind. werden.

weitreichende Auswirkungen auf die Eigenschaften des dung, wenn sie nachträglich oder bei ihrem Einsatz Beide Verfahrensvarianten werden vorteilhaft unter Einwirkung einer Wechselspannung am Träger, einer sogenannten Puls-Bias-Spannung, ausgeführt. Die Einstellung der erfindungsgemäßen Werte für Druckeigenspannung und Härte der Al₂O₃-Schicht auf dem Träger erfolgt durch Anpassung dieser Spannung. Die Begrenzung der Temperatur auf 700°C, vorzugsweise jedoch auf 550°C bei der Herstellung des Verbundkörpers hat Verbundkörpers, Besteht der Träger z.B. aus einem HSS-Stahl, so wird durch die Begrenzung der Temperatur auf maximal 550°C die Vielzahl der vorteilhaften Werkstoff- und Bearbeitungseigenschaften beibehalten. Die direkte Abscheidung der thermodynamisch sta-Phasenumwandlung ist der Grund für die völlige Rißfreiheit des Verbundkörpers. Auch Al₂O₃-Schichten mit einem großen Anteil an r-Al₂O₃ zeigen keinerlei Rißbilohne a-Al₂O₃-Phase erwärmt werden

An einem Ausführungsbeispiel sollen der erfindungsgenatib verbundköper und das Verfahren zu seiner Herstellung näher erfäutert werden. In der zugehöndigen Zeichrung zeigen:

 ig. 1: eine beispielhafte Ausführungsform des Verbundkörpers als Sägeblatt ohne Beschichtung.

dauer (Standweg) aus.

- Fig. 2: einen Schnitt durch einen beschichteten Verbundkörper,
 - Fig. 3: ein Ergebnis der Röntgenfeinstrukturanalyse der außeren Oberflächenschicht und des Tägers aus einem Eisenwerkstoff

Ein Täger 1 aus gehärtetem Werkzeugstahl in Form eines Keissägebätes ist in einem bekannten Vakuurnbeschörthungsprozeß mit eine Schicht zu Ti(CA), versehen. Eine Böhrung 3 dient zum Einspan-

spannen während des Gebrauchs als Werkzeug. Im auch auf deren Flächen 6. In Richtung zur Bohrung 3 fällt die Schichtdicke monoton ab. Der Träger 1 mit der Schicht 2 bilden gemeinsam den Grundkörper, auf dem ken 5 und der Flächen 6 eine Dicke von 4±1 μm. Ihre Schichtdicke fallt ebenfalls in Richtung zur Bohrung 3 setzt worden ist und daß die Al₂O₃-Schicht 7 vollständig nen des Trägers 1 während der weiteren Prozeßschritte Bereich der Sägezähne 4 beträgt die Schichtdicke der Schicht 2 etwa 6±1 µm sowohl auf den Flanken 5 als eine im Vakuum abgeschiedene Al₂O₃-Schicht 7 aufgebracht ist. Die Al₂O₃-Schicht 7 hat im Bereich der Flanmonoton ab. Merkmalbestimmend für den Verbundkörper ist, daß er während der Abscheidung der Al₂O₃-Schicht 7 einer Maximaltemperatur von 500°C ausgezur Herstellung des Verbundkörpers sowie zum Einkristallin ist. Fig. 3 zeigt das Ergebnis der Römigenfeinstrukfuranarlyse der Alg-3-Söhrich 1 und des Trägers 1. Es
wurde mit einem Rörügendiffraktometer und Cur K₁₋
Strahlung gewonnen. Als Abszisse ist der Netizsebenenabstand d bzw. der Glanzwinkel 2 @ dargestellt. Als
Ordinate ist die Intensität der Interferenzen aufgetragen. Es lassen sich die Intenferenzinien der α-Alg-OzPhase und der y-Alg-Oz-Phase erkennen. Weitere metastabile Phasen sind micht vorhanden.

mit einer Konzentration oberhalb der Nachweisgrenze lere Rauheit und einen Reibungskoeffizient gegen Stahl von weniger als 0,15. Auf Grund seiner Eigenschaften Verbundkörper als hochleistungsfähiges Schneidwerkzeug bei der spanenden Bearbeitung von Stählen mit unterbrochenem und kontinuierlichem Schnitt verwendet. Im Vergleich zu herkömmlichen Schneidwerkzeugen zeichnet er sich durch eine höhere Mindest-Druckeigenspannung von 1 GPa (im Beispiel wurde der Bereich der Druckeigenspannung zu 3,0 ± 0,5 GPa bestimmt) sowie eine hohe Härte von 21 GPa. Diese Größe wird durch Mikrohärteprüfung HV 0.01 bestimmt. Eine Elektronenstrahl-Mikroanalyse zeigt Schicht 7 sowie das Fehlen weiterer Verunreinigungen dieses Verfahrens. Der Verbundkörper zeigt eine hervorragende Haftfestigkeit der Oberflächenschichten, eine verglichen mit CVD-Schichten sehr geringe mitt-Belastbarkeit und eine deutlich erhöhte Gebrauchs-Weitere Merkmale der Al₂O₃-Schicht 7 sind eine einen Argon-Gehalt von (0,3 ± 0,1) at% in der Al₂O₃. wird der

Das Verfahren zur Herstellung des Verbundkörpers wird wie folgt ausgeübtt: Der Täger, der aus Werkzeug-stahl und einer darauf aufgebrachten Tij(C.Ny_Schicht besteht, wird nach der Reinigung in eine Valkuumbesteht, wird nach der Reinigung in eine Valkuumbeschlichtungsanlage eingebracht und in bekenmter Weise in einer Niederdruck-Gilmmentlachung chuch einen Aizprozeß vorbehandelt. Durch einen leistungstähtigen Strahlungsheizer im Inneen der Valkuumbeschichtungsanlage wird eine Temperatur des Tägers von 500 °C eingestellt und konstant gehalten. Für die Abscheidung der Abz-Ös-Schlicht wind der Täger unter Nutzung der Bohrung auf rotierenden, stabtörmigen Aufnahmen

4

werden. Zur Erzeugung des Teilchenstromes dient eine stäubungsquellen im Wechsel als Anode und Katode gehaltert, wobei der Abstand zwischen je zwei Trägern 30 mm beträgt. Durch planetenartige Bewegung wird speziellen Sinusgenerator derart verbunden sind, daß erreicht, daß alle zu beschichtenden Flächen des Trägers dem schichtbildenden Teilchenstrom ausgesetzt Anordnung von zwei Magnetron-Zerstäubungsquellen mit Aluminium-Targets, die mit einem leistungsfähigen mit einer Pulswechselfrequenz von 50 kHz beide Zer-

Betriebes der Zerstäubungsanordnung und der genauen Justierung des Sauerstoff-Anteils werden die Magnetron-Zerstäubungsquellen zunächst in reinem der Zerstäubungsanordnung wirken. In der Vakuumbeschichtungsanlage wird ein Druck von 0,1 Pa eingestellt. Das Gas besteht aus Argon und einem Anteil von etwa 25 at% Sauerstoff. Zur Einstellung eines stabilen

તાં

von 8 nm/s auf einem fest angeordneten Träger ent-Strom-Spannungs-Kennlinie und vorgegebene, mittels Argon-Gas gezündet und dann der Sauerstoff-Gehalt so weit erhöht, bis sich ein vorgegebener Punkt in der optischer Spektroskopie kontrollierte Linienintensitäten ergeben. Bei einer in die Magnetron-Zerstäubungsquellen eingespeisten elektrischen Leistung von 30 kW wird eine Abscheiderate für Al₂O₃ erreicht, die einem Werl

8

ເດ່ 30 Magnetron-Zerstäubungsquellen beträgt 30 mm. Die Zerstäubungsquellen ausgesetzt. Der kürzeste Abstand Irager sind weiterhin an ihrer Bohrung elektrisch leitend mit den Aufnahmen verbunden. Die Aufnahmen werden spricht. Die sich bildende Al₂O₃-Schicht ist dem intensiven Puls-Plasma in der Umgebung der Magnetronzwischen den bewegten Trägern und den Targets der

6 ĕ 10 kHz derart zusammengeschaftet, daß sich eine lät einstellt, der einem Ladungsträgerstrom mit einer während des Abscheidens der Al2O3-Schicht mit einer Sinus-Wechselspannungsquelle mit einer Frequenz von effektive Wechselspannung von ± 40 V gegenüber dem Plasma und ein pulsierender Strom wechselnder Polari-

5 20 anlage abscheiden, durch eine hohe Langzeitstabilität aus. Nach Erreichen der vorgegebenen Dicke der Beschichtungsprozeß zur Abscheidung der Al₂O₃ationsvermôgens der Al₂O₃-Schichten, die sich auf 412O3-Schicht werden die Magnetron-Zerstäubungsschichtungsanlage entnommen. Die beschichteten Vermittleren Stromdichte von 1,2 mA/cm² entspricht, bezo-Schicht zeichnet sich trotz des hohen elektrischen Isoallen inneren Wandungen der Vakuumbeschichtungsquellen ausgeschaltet. Nach Abkühlung der beschichtediese der Vakuumbebundkörper stehen ohne weitere thermische Nachbegen auf die aufwachsende Al₂O₃-Schicht. handlungsprozesse für ihren Einsatz bereit. Trager werden

Patentansprüche

ß

ď rung, auf dem mindestens eine Schicht, als die außere Schicht, aus $Al_2 O_3$ in einem Vakuumbe-Vakuumbeschichteter Verbundkörper, bestehend aus einem Träger aus Metall oder einer Metallegie-

dadurch gekennzeichnet, daß auf dem Träger (1) die Al₂O₃-Schicht (7) bei maximal 700 °C, vorzugsweise 550 °C, vollståndig kristallin aufgebracht ist und aus der a-Al2O3-Phase und gegebenenfalls der r-Al₂O₃-Phase mit einer (440)-Textur besteht, eine Druckeigenspannung von mindestens 1 GPa und eine Härte von mindestens 20 GPa hat, und daß in der Al₂O₃-Schicht (7) mit Ausnahme von Argon keine nennenswerten Verunreinigungen ein-<u>t</u> aufgebracht schichtungsprozeß gelagert sind.

Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, daß mindestens eine zwischen der Al2O3-Schicht (7) und dem Träger (1) aufgebrachte Schicht (2) aus einem Metall und/oder einer Metallverbindung aus der Verbundkörper Gruppe Ti, Zr, Cr, Al, Nb, Hf, W besteht. Vakuumbeschichteter

튱 Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Metaliverbindungen Oxide, Nitride, Oxini-Vakuumbeschichteter Verbundkörper nach tride, Karbide oder Carbonitride sind က်

nach den daß die Al₂O₃-Schicht (7) eine Dicke von 1 bis 20 Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, Vakuumbeschichteter Verbundkörper μm, vorzugsweise 3 μm hat. 용 sel mit Schichten aus Metallen der Gruppe Ti, Zr, Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß auf dem Träger (1) neben der äußeren $\mathsf{Al}_2\mathsf{O}_3$ Schicht (7) weitere Schichten aus A₂O₃ im Wech-Cr, Al, Nb, Hf, W und/oder Verbindungen dieser Vakuumbeschichteter Verbundkörper nach Metalle aufgebracht sind.

auf einen stationär angeordneten Träger, abgeschieden wird und daß ein pulstörmiger im Wechsel Schicht im Vakuum aufgebracht wird und dabei die tron-Zerstäuben aufgebracht wird, nach Anspruch Schicht durch gepulste Magnetronzerstäubung bei Zuführung von sauerstoffhaltigern Gas aufgebracht wird, daß die Pulsfrequenz auf 20 bis 100 kHz, vorvon positiven und negativen Ladungsträgem getragener Strom mit einer mittleren Stromdichte von mindestens 1 mA/am² und einer Pulswechselfreteten Verbundkörpers, indem auf dem Träger aus Metall oder einer Metallegierung mindestens eine außere Schicht aus Al2O3 durch reaktives Magne- dadurch gekennzeichnet, daß die Al₂O₃zugsweise 50 kHz, eingestellt wird, daß mit einer Zerstäubungsrate von mindestens 1 nm/s, bezogen quenz von mindestens 5 kHz auf den Träger auf-Verfahren zur Herstellung eines vakuumbeschich-

zeichnet, daß die Al₂O₃-Schicht durch Zerstäuben Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-

zweier gemeinsam wirkender Al-Targets, die wechselweise als Katode und Anode einer Magnetron-Zerstäubungseinrichtung geschaltet werden, aufgebracht wird.

9

EP 0 744 473 A1

Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzelchnet, daß die Al2O3-Schicht durch Zerstäuben eines Al-Targets einer Magnetron-Zerstäubungsenrichtung aufgebracht wird. œ,

2

Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 6 lung, insbesondere durch Magnetron-Zerstäubung bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß besagte Zwischenschichten ebenfalls durch Vakuumbeschichaufgebracht werden.

6

55

К

8

39

35

\$

3

20

55

Nunmer der Anmeldung EP 96 10 6600

EP 0 744 473 A1

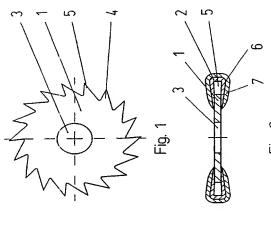
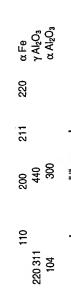


Fig. 2



40.00

32.00

24.00

Fig. 3

100,000 des

82,899

64 888

0.316408

16.00

9.00

RECHERCHERTE SACHGEBIETE (M.C.6) [23] KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IBLCL6) C23C14/08 C23C14/00 Ekhult, H EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT Betriff Asserach 1-9 WO-A-94 25637 (ETEX CORP) 10.November 1994 1-9 * Seite 7, Zeile 7 - Seite 9, Zeile 16 * EP-A-0 539 694 (READ RITE CORP) 5.Mai 1993 1-9 * Spalte 3, Zeile 16 - Spalte 4, Zeile 1 * 4.September 1996 Kennzeichnung des Dokuments mit Angube, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE EP-A-0 605 299 (LORRAINE INST NAT POLYTECH) 6.Juli 1994 * Spalte 5, Zeile 17 - Zeile 49 * Europäisches Patentamt DEN HAAG Kategorie